

雷射光罩製作系統 MASK

◻ 儀器性能：

- 1.Resolution：40nm, 100nm, 200nm, 400nm
- 2.Minimum feature：2 μm
- 3.Laser sources：244nm, 363nm, 413nm, 442nm
- 4.Substrates：glass, silicon or any other flat materials
- 5.Exposure：photoresist
- 6.Image size：140mm x 140mm
- 7.利用雷射直寫光罩或元件結構

◻ 服務項目：

使用規範、公告 (煩請詳閱)：

在線上預約 (實驗件數請填欲製作之光罩片數) 之後，請至「左欄→儀器管理作業→儀器預約申請表格」下載並填寫申請單，再交由申請者之主管或指導教授簽名後，一併自行上傳 FTP 檔案，

IP:140.115.72.55，帳號/密碼：mask，port：

21，甫完成申請步驟，否則一週內將予以取消線上之預約。

◻ 儀器負責人聯絡方式：

儀器專家：許晉瑋教授 (03) 4227151#34466

技術人員：張毓伶小姐 (03) 4227151#57900.57910，ncu7910@ncu.edu.tw

◻ 儀器放置地點：

中央大學電機系 419 室

